(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-31752 (P2001-31752A)

(43)公開日 平成13年2月6日(2001.2.6)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI	テーマコード(参 考)
	ea Ina	1995公司 DIT 4.3	C 0 8 G 64/04	4 J 0 0 2
C 0 8 G			•	
	64/30		64/30	4 J 0 2 9
C 0 8 K	5/49		C08K 5/49	
C 0 8 L	69/00		C 0 8 L 69/00	
			審查請求 未請求 請求項の)数7 OL (全 16 頁)
(21)出願番号 特願平11-207247		特願平11-207247	(71)出願人 000215888	
			帝人化成株式会社	<u>.</u>
(22)出願日		平成11年7月22日(1999.7.22)	東京都千代田区内]幸町1丁目2番2号
			(72)発明者 大平 洋二	
				幸町1丁目2番2号 帝
			人化成株式会社内	
			(74)代理人 100077263	•
				i fett
			弁理士 前田 約 	7I Q
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 芳香族ポリカーボネート樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 ポリカーボネート樹脂本来の透明性を保ちつ つ、成形耐熱性、耐湿熱疲労性、接着性に優れ、また光 ディスク基板内に白色欠点が発生し難い溶融重合法の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 (A) 蛍光スペクトルを測定したとき (励起波長320nm)、基準物質に対する465nm における相対蛍光強度が4×10-3以下および粘度平均分子量が10,000~50,000であり、且つ二価フェノールと炭酸エステルとから溶融重合して得られた 芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部と、(B) 亜燐酸、塩素原子および塩素イオン濃度が1~11000 ppmであり、且つ特定の化学構造を有する6種の化合物から選ばれた少なくとも1種のリン系安定剤0.0001~0.15重量部からなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 蛍光スペクトルを測定したとき (励起波長320 nm)、基準物質に対する465 nm における相対蛍光強度が 4×10^{-3} 以下および粘度平均分子量が10,000~50,000であり、且つ二価フェノールと炭酸エステルとから溶融重合して得られた 芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部と、(B) 亜燐酸、塩素原子および塩素イオン濃度が1~11000 ppmであり、且つ下記一般式(1)で表される化合物(B-1成分)、下記一般式(2)で表される化合物(B-2成分)、下記一般式(3)で表される化合物(B-3成分)、下記一般式(4)で表される化合物(B-3成分)、下記一般式(5)で表される化合物(B-5成分)および下記一般式(6)で表される化合物(B-6成分)から選ばれた少なくとも1種のリン系

安定剤 0.0001~0.15重量部からなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。
【化1】
Arr 0、 0 Arr

$$Ar_3=0$$
 P=0=Ar₃ (3)

【化6】

[式中、Ar1、Ar2、Ar4はアルキル置換基があってもよい芳香族基であって、同一でも異なっていてもよい。またAr3はジアルキル置換芳香族基であって、同一でも異なっていてもよい。さらにR1、R2、R3はアルキル基またはアルキル置換基があってもよい芳香族基であって、同一でも異なっていてもよい。]

【請求項2】 炭酸エステルがジフェニルカーボネート である請求項1記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成 物。

【請求項3】 リン系安定剤が上記一般式(1)で表される化合物(B-1成分)、上記一般式(2)で表される化合物(B-2成分)、上記一般式(3)で表される化合物(B-3成分)からなり、その合計を100重量20%とした時、B-1成分が40~80重量%、B-2成分が5~25重量%およびB-3成分が5~50重量%からなるリン系安定剤組成物である請求項1記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項4】 リン系安定剤がB-3成分である請求項 1記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項5】 リン系安定剤が亜燐酸およびB-3成分からなるリン系安定剤組成物である請求項1記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項6】 リン系安定剤がB-5成分である請求項 30 1記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項7】 リン系安定剤がB-6成分である請求項 1記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリカーボネート 樹脂本来の透明性を保ちつつ、成形耐熱性、耐湿熱疲労 性、接着性に優れ、また光ディスク基板内に白色欠点が 発生し難い溶融重合法の芳香族ポリカーボネート樹脂組 成物に関する。

40 [0002]

【従来の技術】ポリカーボネート樹脂は透明性、耐熱性、耐湿熱性、加工性及び機械的強度等に優れているが故に電気部品、建材部品、自動車部品等に広く利用されている。

【0003】このような芳香族ポリカーボネート樹脂の製造方法としては、ビスフェノールAなどの二価フェノールにホスゲンを直接反応させる方法(界面重合法)、あるいはビスフェノールなどの二価フェノールとジフェニルカーボネートなどのジアリルカーボネートとを溶融50 状態でエステル交換反応させ重合する方法(以下、溶融

3

法と称することがある。) などが知られている。このような製造方法のなかで、二価フェノールとジアリルカーボネートとのエステル交換反応させる方法は、界面重合法による製造に比べて、ホスゲンやメチレンクロライド等のハロゲン化合物を使用する問題がなく、環境に対する負荷が少なく且つ安価に製造できる利点があり、有望な技術である。

【0004】溶融重合したポリカーボネート樹脂の色相 安定性、耐熱性等を向上させるため、溶融重合終了後ポリカーボネート樹脂を溶融状態に保ったまま耐熱安定剤 10を添加する方法が、特開平04-103626号公報、特開平05-9286号公報、特開平05-239333号公報等に開示されている。しかしながら、かかる組成物に使用されている溶融法芳香族ポリカーボネート樹脂は蛍光強度や安定剤中の塩素含有量が考慮されておらず、近年要求される様になった成形耐熱性、耐湿熱疲労性、接着性の改善が必要である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ポリカーボネート樹脂本来の透明性を保ちつつ、成形耐熱性、耐湿熱疲労性、接着性に優れ、また高温高湿下で長時間放置した際、光ディスク基板内に10~100 μ程度の球状の白色欠点が発生し難い溶融重合法の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)蛍光スペクトルを測定したとき(励起波長320nm)、基準物質に対する465nmにおける相対蛍光強度が 4×1 0- 3 以下および粘度平均分子量が10,000~50,000であり、且つ二価フェノールと炭酸エステルとか 30 ら溶融重合して得られた芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部と、(B)亜燐酸、塩素原子および塩素イオン濃度が1~11000ppmであり、且つ下記一般式(1)で表される化合物(B-1成分)、下記一般式(2)で表される化合物(B-2成分)、下記一般式(3)で表される化合物(B-3成分)、下記一般式(4)で表される化合物(B-4成分)、下記一般式

(5)で表される化合物(B-5成分)および下記一般式(6)で表される化合物(B-6成分)から選ばれた少なくとも1種のリン系安定剤0.0001~0.15 重量部からなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物、

[0007]

【0008】 【化8】

$$Ar_2 = 0$$

$$(0.011)$$
 (4.11)
 OH_2C
 CH_2O
 R_2-O-R
 C
 $P-O-R_2$
 OH_2C
 CH_2O

【0013】[式中、Ar1、Ar2、Ar4はアルキル 置換基があってもよい芳香族基であって、同一でも異なっていてもよい。またAr3はジアルキル置換芳香族基 であって、同一でも異なっていてもよい。さらにR1、 R2、R3はアルキル基またはアルキル置換基があっても よい芳香族基であって、同一でも異なっていてもよ い。〕によって達成される。

【 O O 1 4 】以下、本発明についてさらに詳細に説明する。本発明で使用される芳香族ポリカーボネート樹脂は、通常二価フェノールと炭酸エステルとを溶融法で反応させて得られるものである。ここで使用される二価フェノールの代表的な例としては、ハイドロキノン、レゾルシノール、1,6-ジヒドロキシナフタリン、2,6-ジヒドロキシナフタリン、4,4'-ジヒドロキシジフェニル、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、

50 1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニ

ルメタン、ビス $\{(4-E)$ にはキシー3,5ージメチ ル)フェニル}メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) エタン、1,2-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル)エタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)-1-フェニルエタン、ビス(4-ヒドロキシフェ ニル) ジフェニルメタン、ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)-1-ナフチルメタン、2,2-ビス(4-ヒドロ キシフェニル)プロパン(通称ビスフェノールA)、2 (4-ヒドロキシフェニル)-2-(3-ヒドロキシ フェニル) プロパン、2 , 2 – ビス $\{ (4$ – ヒドロキシ 10 シジフェニルスルホキシド、4 , 4 i – ジヒドロキシジ -3-メチル)フェニル}プロパン、2,2-ビス {(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチル)フェニル}プ ロパン、2,2-ビス{(3,5-ジブロモ-4-ヒド ロキシ)フェニル}プロパン、2,2-ビス{(3,5 ージクロロー4ーヒドロキシ)フェニル}プロパン、 2, 2-ビス { (3-ブロモー4-ヒドロキシ) フェニ ル}プロパン、2,2ービス {(3-クロロー4-ヒド ロキシ)フェニル}プロパン、4-ブロモレゾルシノー ル、2,2-ビス {(3-イソプロピル-4-ヒドロキ シ)フェニル}プロパン、2,2ービス{(3-フェニ ルー4-ヒドロキシ)フェニル}プロパン、2,2-ビ ス { (3-エチルー4-ヒドロキシ) フェニル} プロパ ン、2,2-ビス { (3-n-プロピルー4-ヒドロキ シ) フェニル $\}$ プロパン、2, 2-ビス $\{(3-sec)$ ーブチルー4ーヒドロキシ)フェニル}プロパン、2, $2-\forall \lambda \{(3-tert-) \neq \lambda -4-t \neq \lambda \}$ フェニル}プロパン、2,2-ビス{(3-シクロヘキ シルー4ーヒドロキシ)フェニル}プロパン、2,2-ビス { (3-メトキシー4-ヒドロキシ) フェニル } プ ロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキ サフルオロプロパン、1,1-ジブロモ-2,2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) エチレン、1,1-ジクロ ロー2, 2ービス { (3ーフェノキシー4ーヒドロキ シ)フェニル}エチレン、エチレングリコールビス(4 ーヒドロキシフェニル) エーテル、2,2ービス(4-ヒドロキシフェニル) ブタン、2,2-ビス(4-ヒド ロキシフェニル) -3-メチルブタン、2,2-ビス ン、2, 4 - \forall 2, 4 - \forall 4 - 4 + チルブタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) イソブタン、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル) ペンタン、2 , 2 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) -4-メチルペンタン、3、3-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)ペンタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) -4-イソプロピルシクロヘキサン、1,1 ービス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリ メチルシクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル)シクロドデカン、9,9ービス(4ーヒドロ キシフェニル)フルオレン、9,9-ビス {(4-ヒド

ロキシ-3-メチル)フェニル $\}$ フルオレン、 α , α ービス(4-ヒドロキシフェニル)ーoージイソプロピ ルベンゼン、 α , α ' -ビス(4 -ヒドロキシフェニ ル)-m $-ジイソプロピルベンゼン、<math>\alpha$, α '-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-p-ジイソプロピルベン ゼン、1,3ービス(4ーヒドロキシフェニル)-5, 7ージメチルアダマンタン、4,4'ージヒドロキシジ フェニルスルホン、ビス {(3,5-ジメチルー4ーヒ ドロキシ)フェニル}スルホン、4,4'ージヒドロキ フェニルスルフィド、4,4'ージヒドロキシジフェニ ルケトン、4,4'-ジヒドロキシジフェニルエーテル および4,4'ージヒドロキシジフェニルエステルなど があげられ、これらは単独または2種以上を混合して使 用できる。

【0015】なかでもビスフェノールA、2,2-ビス {(4-ヒドロキシー3-メチル)フェニル}プロパ ン、2,2-ビス{(3,5-ジブロモ-4-ヒドロキ シ)フェニル}プロパン、エチレングリコールビス(4 ーヒドロキシフェニル)エーテル、2,2ービス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2 ービス(4-ヒドロキシフェニル)ブタン、1,1-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン(1, 1)ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー3、3、5ートリ メチルシクロヘキサン、4,4'ージヒドロキシジフェ ニルスルホン、ビス { (3,5-ジメチル-4-ヒドロ キシ)フェニル}スルホン、4,4'ージヒドロキシジ フェニルスルホキシド、4,4'ージヒドロキシジフェ ニルスルフィド、および4,4'ージヒドロキシジフェ ニルケトンからなる群より選ばれた少なくとも1種のビ スフェノールより得られる単独重合体または共重合体が 好ましく、特に、ビスフェノールAの単独重合体が好ま しく使用される。

【0016】炭酸エステルとしては、具体的には、ジフ ェニルカーボネート、ジトリルカーボネート、ビス(ク ロロフェニル)カーボネート、m-クレジルカーボネー ト、ジナフチルカーボネート、ビス(ジフェニル)カー ボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネー ト、ジブチルカーボネート、ジシクロヘキシルカーボネ 40 ートなどが挙げられるが、これらに限定されない。好ま しくは、ジフェニルカーボネートを使用する。これら炭 酸エステルもまた、単独で用いても良く、また二種以上 を組み合わせて用いても良い。

【0017】上記二価フェノールと炭酸エステルを溶融 法によって反応させて芳香族ポリカーボネート樹脂を製 造するに当っては、必要に応じて触媒、末端停止剤、二 価フェノールの酸化防止剤等を使用してもよい。また芳 香族ポリカーボネート樹脂は三官能以上の多官能性芳香 族化合物を共重合した分岐芳香族ポリカーボネート樹脂 50 であっても、芳香族または脂肪族の二官能性カルボン酸

げられる。

を共重合したポリエステルカーボネート樹脂であってもよく、また、得られた芳香族ポリカーボネート樹脂の2種以上を混合した混合物であってもよい。

7

【0018】三官能以上の多官能性芳香族化合物として は、フロログルシン、フロログルシド、または4,6-ジメチルー2,4,6ートリス(4ーヒドロキジフェニ (μ) ヘプテン-2, 2, 4, 6-トリメチル-2, 4, 6-トリス (4-ヒドロキシフェニル) ヘプタン、1, 3,5-トリス(4-ヒドロキシフェニル)ベンゼン、 1, 1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタ ン、1,1,1-トリス(3,5-ジメチルー4ーヒド ロキシフェニル) エタン、2,6-ビス(2-ヒドロキ シー5ーメチルベンジル)ー4ーメチルフェノール、4 - {4-[1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エ チル]ベンゼン $\} - \alpha$, $\alpha - \vec{y}$ メチルベンジルフェノー ル等のトリスフェノール、テトラ(4-ヒドロキシフェ ニル)メタン、ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル) ケトン、1,4ービス(4,4ージヒドロキシトリフェ ニルメチル) ベンゼン、又はトリメリット酸、ピロメリ ット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸及びこれらの 酸クロライド、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(3'一フェノキシカルボニルー4'一ヒドロキシフェ ニル)プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2 (3) ーカルボキシー4) ーヒドロキシフェニル)プ ロパン等が挙げられ、中でも1,1,1ートリス(4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1,1-トリス (3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) エタン が好ましく、特に1、1、1-トリス(4-ヒドロキシ フェニル)エタンが好ましい。

【0019】溶融法による反応は、通常二価フェノールと炭酸エステルとのエステル交換反応であり、不活性ガスの存在下に二価フェノールと炭酸エステルとを加熱しながら混合して、生成するアルコールまたはフェノールを留出させる方法により行われる。反応温度は生成するアルコールまたはフェノールの沸点等により異なるが、通常120~350℃の範囲である。反応後期には系を10~0.1Torr程度に減圧して生成するアルコールまたはフェノールの留出を容易にさせる。反応時間は通常1~4時間程度である。

【0020】また、溶融法において重合速度を速めるために重合触媒を用いることができ、かかる重合触媒としては、例えば(i)アルカリ(土類)金属化合物および/または(ii)含窒素塩基性化合物よりなる触媒を用いて縮合される。

【0021】触媒として用いられるアルカリ金属化合物としては、例えばアルカリ金属の水酸化物、炭化水素化物、炭酸塩、酢酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、亜流酸塩、シアン酸塩、チオシアン酸塩、ステアリン酸塩、水素化ホウ素塩、安息香酸塩、リン酸水素化物、ビスフェノール、フェノールの塩等が挙げられる。

【0022】具体例としては、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、水酸化リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭 酸水素カリウム、炭酸水素リチウム、炭酸ナトリウム、 炭酸カリウム、炭酸リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カ リウム、酢酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウ ム、硝酸リチウム、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウ ム、亜硝酸リチウム、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウ ム、亜硫酸リチウム、シアン酸ナトリウム、シアン酸カ リウム、シアン酸リチウム、チオシアン酸ナトリウム、 10 チオシアン酸カリウム、チオシアン酸リチウム、ステア リン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ステアリン 酸リチウム、水酸化ホウ素ナトリウム、水酸化ホウ素リ チウム、水素化ホウ素カリウム、フェニル化ホウ素ナト リウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息 香酸リチウム、リン酸水素ジナトリウム、リン酸水素ジ カリウム、リン酸水素ジリチウム、ビスフェノールAの ジナトリウム塩、ジカリウム塩、ジリチウム塩、フェノ

8

1 【0023】触媒として用いられるアルカリ土類金属化合物としては、例えばマグネシウム、カルシウム、バリュウム等のアルカリ土類金属の水酸化物、炭化水素化物、炭酸塩、酢酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、亜流酸塩、シアン酸塩、チオシアン酸塩、ステアリン酸塩、水素化ホウ素塩、安息香酸塩、リン酸水素化物、ビスフェノール、フェノールの塩等が挙げられる。

ールのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩などが挙

【0024】これらアルカリ金属化合物及びアルカリ土類金属化合物中では、アルカリ金属化合物が溶融重合の触媒として好適である。

30 【0025】触媒としてのアルカリ金属化合物は、二価フェノール1モルに対し10⁻⁸~10⁻⁵モルの範囲で使用しうる。上記使用範囲を逸脱すると、得られる芳香族ポリカーボネートの諸物性に悪影響を及ぼしたり、また、エステル交換反応が充分に進行せず高分子量の芳香族ポリカーボネート樹脂が得られない等の問題があり好ましくない。

【0026】また、触媒としての含窒素塩基性化合物としては、例えばテトラメチルアンモニウムヒドロキシド(Me4NOH)、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド(Et4NOH)、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド(Bu4NOH)、ベンジルトリメチルアンモニウムヒドロキシド($\phi-CH_2$ (Me) $_3NOH$)、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシドなどのアルキル、アリール、アルキルアリール基などを有するアンモニウムヒドロオキシド類、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジメチルベンジルアミン、ヘキサデシルジメチルアミンなどの3級アミン類、あるいはテトラメチルアンモニウムボロハイドライド($Me4NBH_4$)、テトラブチルアンモニウムボロハイドライド

50 (Bu4NBH4)、テトラブチルアンモニウムテトラフ

ェニルボレート(Bu4NBPh4)、テトラメチルアン モニウムテトラフェニルボレート(Me4NBPh4)な どの塩基性塩などを挙げることができる。これらの中 で、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド(Me4N OH)、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド(Et 4NOH)、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド (Bu4NOH)が好ましく、特にテトラメチルアンモニウムヒドロキシド(Me4NOH)が好ましい。

【0027】上記含窒素塩基性化合物は、含窒素塩基性化合物中のアンモニウム窒素原子が二価フェノール1 10 ル当り $1\times10^{-5}\sim1\times10^{-3}$ 当量となる割合で用いるのが好ましい。より好ましい割合は同じ基準に対し $2\times10^{-5}\sim7\times10^{-4}$ 当量となる割合である。特に好ましい割合は同じ基準に対し $5\times10^{-5}\sim5\times10^{-4}$ 当量となる割合である。

【0028】本発明においては所望により、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルコキシド類、アルカリ金属やアルカリ土類金属の有機酸塩類、亜鉛化合物類、ホウ素化合物類、アルミニウム化合物類、珪素化合物類、ゲルマニウム化合物類、有機スズ化合物類、鉛化合物類、オスミウム化合物類、アンチモン化合物類、公ンガン化合物類、チタン化合物類、ジルコニウム化合物類などの通常エステル化反応、エステル交換反応に使用される触媒を用いることができる。触媒は単独で使用してもよいし、2種以上組み合わせ使用してもよい。これらの重合触媒の使用量は、原料の二価フェノール1モルに対し、好ましくは $1\times10^{-8}\sim5\times10^{-6}$ 当量、より好ましくは $1\times10^{-8}\sim5\times10^{-6}$ 当量の範囲で選ばれる。

【0029】本発明の溶融重合された芳香族ポリカーボネート樹脂では、その相対蛍光強度を 4×10^{-3} 以下に抑えることが肝要である。この相対蛍光強度が 4×10^{-3} を越えると、芳香族ポリカーボネート樹脂シートの接着性や印刷性の低下等の新たな問題が発生する。この相対蛍光強度は 3×10^{-3} 以下が好ましく、最も好ましくは 2×10^{-3} 以下である。

【0030】このような芳香族ポリカーボネート樹脂の熱分解、および機械的分解が少ない蛍光強度が特定値以下の芳香族ポリカーボネートを得るためには、下記のようにエステル交換触媒の量を規定すること、該エステル交換触媒をスルホン酸系化合物により失活すること、ポリカーボネートの分子末端についてヒドロキシ基の全分子末端にしめる割合を規定すること、および芳香族ポリカーボネートの分子末端を封止することが好ましい。

【0031】また溶融重縮合反応における芳香族ポリカーボネート樹脂温度を常に255℃以下に保つことが、熱分解、および機械的分解が少ない蛍光強度が特定値以下の芳香族ポリカーボネートを得るために好ましい。

【0032】また重合槽撹拌翼の撹拌について、下記式 撹拌剪断速度=撹拌翼の周速/反応釜と撹拌翼の隙間の 長さ[ここで撹拌剪断速度の単位は1/sec、撹拌翼

50

の周速の単位はcm/sec撹拌翼の隙間の長さの単位はcmである]で表される重合槽撹拌翼の撹拌剪断速度(単位:1/sec)を撹拌翼半径(単位:cm)の2乗で割った数値を $0.1\sim0.001$ ($1/sec\times cm^2$)とすることが、熱分解、および機械的分解が少ない蛍光強度が特定値以下の芳香族ポリカーボネートを得るために好ましい。

【0033】これらの芳香族ポリカーボネートの製造における触媒系については、塩基性窒素化合物と、アルカリ金属化合物を併用し、アルカリ金属化合物の使用量をビスフェノールA1モル当り5.0×10⁻⁶モル以下に抑えることによりエステル交換反応も、工業的に有利に進み、流動性、色調良好なポリカーボネートを得ることができる。

【0034】また、かかる重合反応において、フェノー ル性の末端基を減少するために、重縮反応の後期あるい は終了後に、例えばフェノール、p-t-ブチルフェノ ール、p-t-ブチルフェニルフェニルカーボネート、 p-t-ブチルフェニルカーボネート、p-クミルフェ ノール、p-クミルフェニルフェニルカーボネート、p ークミルフェニルカーボネート、ビス(クロロフェニ ル)カーボネート、ビス(ブロモフェニル)カーボネー ト、ビス(ニトロフェニル)カーボネート、ビス(フェ ニルフェニル)カーボネート、クロロフェニルフェニル カーボネート、ブロモフェニルフェニルカーボネート、 ニトロフェニルフェニルカーボネート、ジフェニルカー ボネート、メトキシカルボニルフェニルフェニルカーボ ネート、2,2,4ートリメチルー4ー(4ーヒドロキ シフェニル)クロマン2,4,4-トリメチルー2ー (4-ヒドロキシフェニル)クロマンおよびエトキシカ ルボニルフェニルフェニルカーボネート等の化合物を加 えることが好ましい。なかでも2-クロロフェニルフェ ニルカーボネート、2-メトキシカルボニルフェニルフ ェニルカーボネートおよび2-エトキシカルボニルフェ ニルフェニルカーボネートが好ましく、特に2-メトキ シカルボニルフェニルフェニルカーボネートが好ましく 使用される。

【0035】本発明において末端封鎖剤を用いて芳香族ポリカーボネート樹脂の末端を封鎖することが好ましい。また、末端封鎖剤を添加する前の芳香族ポリカーボネート樹脂の末端水酸基濃度を全末端に対して20モル%以上、好ましくは30モル%以上、さらに好ましくは40モル%以上に制御することが好ましい。かくすることにより、特定の末端基を高い割合で導入でき、芳香族ポリカーボネート樹脂の改質効果を高めることができる。通常は、芳香族ポリカーボネート樹脂に末端封鎖剤を用いることが有利である。また、末端封鎖剤を添加する前の芳香族ポリカーボネート樹脂水酸基の末端割合は、原料であたボリカーボネート樹脂水酸基の末端割合は、原料であ

る二価フェノールとジフェニルカーボネートの仕込み比 によってコントロールすることができる。ここで芳香族 ポリカーボネート樹脂の一定量における末端水酸基濃度 のモル数は、常法により¹H-NMRにより決定でき る。本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂の末端水酸基 濃度は、全末端に対して5~70モル%が好ましく、よ り好ましくは10~60モル%、さらに好ましくは10 ~40モル%である。末端水酸基濃度がかかる範囲にあ ると、分子量低下、色相等が向上する。また、光ディス ク用途の芳香族ポリカーボネート樹脂の末端水酸基濃度 10 は、全末端に対して5~70モル%が好ましく、より好 ましくは20~70モル%、さらに好ましくは30~6 0モル%である。

1 1

【0036】本発明では、芳香族ポリカーボネート樹脂 中の触媒の活性を中和する失活剤を用いることが好まし い。この失活剤の具体例としては、例えばベンゼンスル ホン酸、pートルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸 メチル、ベンゼンスルホン酸エチル、ベンゼンスルホン 酸ブチル、ベンゼンスルホン酸オクチル、ベンゼンスル ホン酸フェニル、pートルエンスルホン酸メチル、pー トルエンスルホン酸エチル、pートルエンスルホン酸ブ チル、p-トルエンスルホン酸オクチル、p-トルエン スルホン酸フェニルなどのスルホン酸エステル;さら に、トリフルオロメタンスルホン酸、ナフタレンスルホ ン酸、スルホン化ポリスチレン、アクリル酸メチル - ス ルホン化スチレン共重合体、ドデシルベンゼンスルホン 酸-2-フェニル-2-プロピル、ドデシルベンゼンス ルホン酸-2-フェニル-2-ブチル、オクチルスルホ ン酸テトラブチルホスホニウム塩、デシルスルホン酸テ トラブチルホスホニウム塩、ベンゼンスルホン酸テトラ ブチルホスホニウム塩、ドデシルベンゼンスルホン酸テ トラエチルホスホニウム塩、ドデシルベンゼンスルホン 酸テトラブチルホスホニウム塩、ドデシルベンゼンスル ホン酸テトラヘキシルホスホニウム塩、ドデシルベンゼ ンスルホン酸テトラオクチルホスホニウム塩、デシルア ンモニウムブチルサルフェート、デシルアンモニウムデ シルサルフェート、ドデシルアンモニウムメチルサルフ ェート、ドデシルアンモニウムエチルサルフェート、ド デシルメチルアンモニウムメチルサルフェート、ドデシ ルジメチルアンモニウムテトラデシルサルフェート、テ 40 トラデシルジメチルアンモニウムメチルサルフェート、 テトラメチルアンモニウムヘキシルサルフェート、デシ ルトリメチルアンモニウムヘキサデシルサルフェート、 テトラブチルアンモニウムドデシルベンジルサルフェー ト、テトラエチルアンモニウムドデシルベンジルサルフ ェート、テトラメチルアンモニウムドデシルベンジルサ ルフェート等の化合物を挙げることができるが、これら に限定されない。これらの化合物を二種以上併用するこ ともできる。

ニウム塩型の失活剤はそれ自身200℃以上でも特に安 定である。そしてその失活剤を芳香族ポリカーボネート 樹脂に添加した場合すみやかに重縮合反応触媒を中和 し、目的とする芳香族ポリカーボネート樹脂を得ること ができる。即ち、重合封鎖反応後に生成する芳香族ポリ カーボネートに対し、失活剤を好ましくは0.01~5 00ppmの割合で、より好ましくは0.01~300 ppm、特に好ましくは0.01~100ppmの割合 で使用される。

【0038】また、かかる失活剤は、重縮合反応触媒に 対する割合では、重縮合反応触媒1モル当り0.5~5 〇モルの割合で用いるのが好ましい。失活剤を末端封鎖 後の芳香族ポリカーボネート樹脂に添加する方法には特 に限定されない。例えば、反応生成物である芳香族ポリ カーボネート樹脂が溶融状態にある間にこれらを添加し てもよいし、一旦芳香族ポリカーボネート樹脂をペレタ イズした後再溶融して添加してもよい。前者において は、末端封鎖反応が終了して得られる溶融状態にある重 合槽内または押出機内の反応生成物である芳香族ポリカ ーボネート樹脂が溶融状態にある間に、これらを添加す

【0039】本発明の溶融重合された芳香族ポリカーボ ネート樹脂では、その反応を促進するために重合触媒を 用いた場合は、重合反応後にも重合触媒が残存すること が多い。この残存した触媒を重合反応終了後、そのまま 放置すると重合触媒の触媒活性により芳香族ポリカーボ ネート樹脂の分解や再反応が起こる弊害があるので、か かる残存触媒活性を抑制することが好ましい。

【0040】本発明のリン系安定剤は亜燐酸、塩素原子 および塩素イオン濃度が1~11000ppmであり、 且つ上記一般式(1)で表される化合物(B-1成 分)、上記一般式(2)で表される化合物(B-2成 分)、上記一般式(3)で表される化合物(B-3成 分)、上記一般式(4)で表される化合物(B-4成 分)、上記一般式(5)で表される化合物(B-5成 分)および上記一般式(6)で表される化合物(B-6 成分)から選ばれた少なくとも1種のリン系安定剤であ

【0041】本発明のB-1成分の具体的例としては、 テトラキス $(2, 4-\tilde{y}-iso-$ プロピルフェニル) -4,4'ービフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 4-ジ-n-ブチルフェニル)-4, 4'-ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス(2,4-ジーt ertーブチルフェニル)-4,4'ービフェニレンジ ホスホナイト、テトラキス(2,4-ジーtert-ブ チルフェニル)-4,3'-ビフェニレンジホスホナイ ト、テトラキス(2,4-ジーtert-ブチルフェニ ル)-3,3'ービフェニレンジホスホナイト、テトラ

【0037】失活剤の中でホスホニウムもしくはアンモ 50 4゜-ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス(2,

6-ジーn-ブチルフェニル)-4,4'-ビフェニレ ンジホスホナイト、テトラキス(2,6-ジーtert ーブチルフェニル)-4,4'-ビフェニレンジホスホ ナイト、テトラキス(2,6-ジーtert-ブチルフ ェニル)-4, 3' -ビフェニレンジホスホナイト、テ トラキス(2,6-ジーtert-ブチルフェニル)-3,3'ービフェニレンジホスホナイト等があげられ、 テトラキス (ジーtertーブチルフェニル) ービフェ ニレンジホスホナイトが好ましく、テトラキス(2,4 スホナイトがより好ましい。このテトラキス(2,4-ジーtertーブチルフェニル) ービフェニレンジホス ホナイトは、2種以上の混合物が好ましく、具体的には テトラキス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)-4, 4'-ビフェニレンジホスホナイト(B-1-1 成分)、テトラキス(2,4-ジーtert-ブチルフ ェニル)-4,3'-ビフェニレンジホスホナイト(B -1-2成分) および、テトラキス(2,4-ジーte rt-ブチルフェニル)-3,3'-ビフェニレンジホ スホナイト(B-1-3成分)の3種の混合物がより好 20 ましい。また、この混合物の混合比は、B-1-1成 分、B-1-2成分およびB-1-3成分を重量比で1 00:37~64:4~14の範囲が好ましく、10 $0:40\sim60:5\sim11$ の範囲がより好ましい。

13

【0042】本発明のB-2成分の具体的例としては、 $\forall 2, 4 - \vec{y} - i so - プロピルフェニル) - 4 -$ フェニルーフェニルホスホナイト、ビス(2,4ージー n-ブチルフェニル)-3-フェニル-フェニルホスホ ナイト、ビス(2,4-ジーtert-ブチルフェニ ル) -4-フェニル-フェニルホスホナイト、ビス (2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル) - 3-フェニルーフェニルホスホナイトビス(2,6-ジーiso ープロピルフェニル) -4-フェニルーフェニルホスホ ナイト、ビス(2,6-ジーn-ブチルフェニル)-3 ーフェニルーフェニルホスホナイト、ビス(2,6ージ -tert-ブチルフェニル)-4-フェニル-フェニ ルホスホナイト、ビス(2,6-ジーtert-ブチル フェニル)-3-フェニルーフェニルホスホナイト等が*

*あげられ、ビス(ジーtert-ブチルフェニル)-フ ェニルーフェニルホスホナイトが好ましく、ビス(2, 4-ジーtert-ブチルフェニル)-フェニルーフェ ニルホスホナイトがより好ましい。このビス(2、4-ジーtert-ブチルフェニル) -フェニル-フェニル ホスホナイトは、2種以上の混合物が好ましく、具体的 にはビス(2,4-ジーtert-ブチルフェニル)-4-フェニルーフェニルホスホナイト(B-2-1成 分) および、ビス(2,4-ジーtert-ブチルフェ ージーtertーブチルフェニル)ービフェニレンジホ 10 ニル)ー3ーフェニルーフェニルホスホナイト(B-2 -2成分)の混合物がより好ましい。また、この混合物 の混合比は、B-2-1成分および、B-2-2成分を 重量比で5:1~4の範囲が好ましく、5:2~3の範 囲がより好ましい。

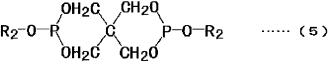
> 【 0 0 4 3 】本発明の B − 3 成分の具体的例としては、 トリス (ジメチルフェニル) ホスファイト、トリス (ジ エチルフェニル) ホスファイト、トリス (ジーiso-プロピルフェニル) ホスファイト、トリス (ジーn-ブ チルフェニル) ホスファイト、トリス(2,4-ジーセ ertーブチルフェニル) ホスファイト、トリス(2, 6-ジーtertーブチルフェニル) ホスファイト等が あげられ、トリス(ジアルキル置換フェニル)ホスファ イトが好ましく、トリス (ジーtertーブチルフェニ ル) ホスファイトがより好ましく、トリス(2,4-ジ - tert-ブチルフェニル) ホスファイトが特に好ま しい。かかるB-3成分の化合物は1種または2種以上 の混合物であってもよい。

【 ○ ○ 4 4 】本発明の B − 4 成分の具体的例としては、 トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、ト 30 リブチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、ト リクレジルホスフェート、クレジル・ジフェニルホスフ ェート等があげられ、トリメチルホスフェート、トリフ ェニルホスフェートが好ましく、トリメチルホスフェー トが最も好ましい。

【0045】本発明のB-5成分は下記一般式(5)で 表される化合物であり、

[0046]

【化13】



【0047】「式中、R2はアルキル基またはアルキル 置換基があってもよい芳香族基であって、同一でも異な っていてもよい。] その具体的例としては、R2がフェ ニル基、2,4-ジーtert-ブチルフェニル、4-メチルー2,6-ジーtert-ブチルフェニル、オク タデシル基、ノニルフェニル基のリン系安定剤があげら れ、2,4-ジーtert-ブチルフェニル、オクタデ シル基が好ましく、ジオクタデシルペンタエリスリトー※50

※ルジホスファイトが最も好ましい。

【0048】本発明のB-6成分は下記一般式(6)で 表される化合物であり、

[0049]

【化14】

【0050】[式中、Ar4はアルキル置換基があってもよい芳香族基であって、同一でも異なっていてもよい。Rsはアルキル基またはアルキル置換基があってもよい芳香族基であって、同一でも異なっていてもよい。] その具体的例としては、Ar4がフェニル基、トルイル基、2,4ージーtertーブチルフェニル等であり、また、Rsはメチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、tーブチル基等である。最も好ましい例としては、ジメチルフェニルホスホネートがあげられる。

【0051】本発明のリン系安定剤は、B-1成分、B-2成分およびB-3成分からなるリン系安定剤組成物、または亜燐酸およびB-3成分からなるリン系安定剤組成物、またはB-3成分、またはB-5成分、またはB-6成分が好ましい。

【0052】本発明のB-1成分、B-2成分およびB-3成分からなるリン系安定剤組成物は、その合計を100重量%とした時、B-1成分が $40\sim80$ 重量%、B-2成分が $0\sim25$ 重量%およびB-3成分が $5\sim50$ 重量%であるリン系安定剤組成物が好ましい。より好ましくは、B-1成分が $40\sim80$ 重量%、B-2成分が $5\sim25$ 重量%およびB-3成分が $5\sim50$ 重量%であり、最も好ましくは、B-1成分が5>250重量%、B-2成分が $5\sim25$ 10重量%が $5\sim25$ 10重量%であり、最も好ましくは、B-1成分が5>210重量%である。

【0053】 亜燐酸およびB-3成分からなるリン系安定剤組成物は、その合計を100重量%とした時、亜燐酸が $1\sim80$ 重量%およびB-3成分が $20\sim99$ 重量%であるリン系安定剤組成物が好ましい。より好ましくは、亜燐酸が $10\sim60$ 重量%およびB-3成分が $40\sim90$ 重量%であり、最も好ましくは、亜燐酸が $20\sim45$ 重量%およびB-3成分が $55\sim80$ 重量%である。

【0054】本発明のリン系安定剤またはその組成物の量は、芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して、0.0001~0.15重量部の範囲であり、0.002~0.15重量部の範囲がより好ましく、0.02~0.1重量部の範囲が最も好ましい。

【0055】亜燐酸およびB-3成分からなるリン系安定剤組成物の含有量は、芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して、亜燐酸が0.0001~0.00 20(好ましくは、0.0001~0.0015、より好ましくは、0.0001~0.0010)重量部およびB-3成分が0.0005~0.0300(好ましく は、0.0005~0.0300、より好ましくは、 0.0010~0.0200) 重量部の範囲が好まし

【0056】本発明でいう「B-1成分~B-6成分の リン系安定剤または、その組成物(以下、リン系安定剤 組成物と総称する)中に含まれる塩素原子および塩素イ オン」とは、本発明のリン系安定剤または、その組成物 に含有した塩素化合物に由来するものである。その塩素 化合物は、例えば、製造過程において該安定剤中に生じ たり、原料の段階から存在していたものであって、か つ、精製時に除去しきれないものである。これらの塩素 化合物は、具体的に、製造(反応、精製など)時に使用 した塩素系溶媒、塩素系触媒、未反応塩素、副生したハ ロゲン化水素、副生したハロゲン化水素のアンモニウム やアミン塩などを挙げることができる。

【0057】該リン系安定剤組成物に含有する塩素化合物を低減する方法には、安定剤の製造において、精製を強化する方法がある。例えば、溶媒を使用した洗浄による精製の場合、洗浄用溶媒を増やしたり、洗浄回数を多くしたり、塩素化合物を選択的に溶解しやすい溶媒を用いること等を挙げることができる。蒸留、あるいは、昇華による精製の場合は、精留塔部を長くして蒸留段数を増やして、分離能を上げる方法等がある。

【0058】また、該リン系安定剤組成物に含有する塩素化合物を低減するために、製造における合成反応終了直後でかつ精製前の時点において、塩素化合物を少なくしておくことも有効である。例えば、使用する塩素系触媒の量を減らすこと、塩素を含まない触媒を用いること、反応溶媒として使用する塩素系溶媒の量を減らすこと、塩素系溶媒を使用しないこと、反応をより完全に終結させること等をあげることができる。反応をより完全に終結させるためには、反応時間を長くしたり、反応温度を上げたり、より活性な触媒を使用したり、原料の仕込みにおいて「塩素化合物に対するフェノール化合物のモル比」を大きくしたり、製造工程に脱塩化水素反応がある場合は、塩化水素の補足効率をあげる方法等を挙げることができる。

【0059】また、該リン系安定剤組成物に「塩化水素 と塩化水素補足剤との反応生成物」を含有する場合、こ 40 れを低減するために、これまで述べた方法以外に、精製 段階で除去しやすい「塩化水素と塩化水素補足剤との反 応生成物」となるような塩化水素補足剤を使用すること 等が挙げられる。

【0060】該リン系安定剤の製造において、触媒として塩素系触媒を使用し、該安定剤中にこの塩素系触媒やそれに由来する塩素系化合物が残存する場合、それらを低減する方法として、これまで述べた方法以外に、精製段階で除去しやすいものを塩素系触媒として選択する方法を挙げることができる。

50 【0061】該リン系安定剤の製造において、溶媒とし

て塩素系溶媒を使用する場合、該安定剤中の塩素系溶媒 を低減するには、これまで述べた方法以外に、精製段階 で非塩素系の溶媒で洗浄したり、乾燥時間を延長する方

【0062】該リン系安定剤に含有する塩素化合物を低減する方法として、これまで述べた方法を安定剤の生産効率や収率を犠牲にすることなく実施するのが好ましい。しかしながら、本発明の目的を達成するためには、安定剤の生産効率や収率を低下させても、これまで述べた方法を実施してもよい。

法等があげられる。

【0063】本発明における「塩素原子および塩素イオン濃度」は、任意の方法で測定することができる。例えば、化学分析法、蛍光X線法、燃焼クロル法、ヘッドスペースガスクロマトグラフィー法、パージアンドトラップガスクロマトグラフィー法をあげることができる。その中でも、特に好ましいのは、蛍光X線法であり、塩素原子と塩素イオンを同時に測定できる。

【0064】かかる塩素原子および塩素イオン濃度は $1\sim11000$ ppmであり、好ましくは $1\sim8000$ ppmであり、より好ましくは $1\sim3000$ ppmである。

【0065】B-1成分に含有する塩素原子および塩素イオンを完全に取除くことは工業的に困難な面があり、経済的な観点からその濃度は $1\sim20000ppm$ であり、好ましくは $1\sim14500ppm$ であり、より好ましくは $1\sim5500ppm$ である。

【0066】B-2成分に含有する塩素原子および塩素イオンを完全に取除くことは工業的に困難な面があり、経済的な観点からその濃度は $1\sim20000ppm$ であり、好ましくは $1\sim14500ppm$ であり、より好ましくは $1\sim5500ppm$ である。

【0067】B-3成分に含有する塩素原子および塩素イオンを完全に取除くことは工業的に困難な面があり、経済的な観点からその濃度は $0.1\sim50ppm$ であり、好ましくは $0.1\sim40ppm$ であり、より好ましくは $10\sim40ppm$ である。

【0068】また、芳香族ポリカーボネート樹脂には必要に応じて例えば離型剤、トリアゾール系、アセトフェノン系、サリチル酸エステル系等の紫外線吸収剤、ブルーイング剤、テトラブロモビスフェノールA、テトラブロモビスフェノールAの低分子量ポリカーボネート、デカブロモフェニルエーテル等の難燃剤(3~15重量%)、染料、カーボンブラック、酸化チタン等の着色剤(0.01~10重量%)、光拡散剤、滑剤、クマリン、ナフタルイミド、オキサゾール化合物等の蛍光増白剤(0.01~0.1重量%)、帯電防止剤等を配合してもよい。

【0069】本発明のリン系安定剤と併用できる熱安定 剤としては、例えばトリフェニルホスファイト、トリス ノニルフェニルホスファイト、トリデシルホスファイ 1.8

ト、トリオクチルホスファイト、トリオクタデシルホス ファイト、ジデシルーモノフェニルホスファイト、ジオ クチルーモノフェニルホスファイト、ジイソプロピルー モノフェニルホスファイト、モノブチルージフェニルホ スファイト、モノデシルージフェニルホスファイト、モ ノオクチルージフェニルホスファイト、ビス(2,6-ジーtertーブチルー4ーメチルフェニル)ペンタエ リスリトールージーホスファイト、2,2ーメチレンビ ス(4,6-ジ-tert-ブチルフェニル)オクチル10 ホスファイト、ビス (ノニルフェニル) ペンタエリスリ トールージーホスファイト、ビス(2,4ージーter t-ブチルフェニル)ペンタエリスリトール-ジーホス ファイト、テトラキス(2,4-ジーtert-ブチル フェニル)-4,4-ジフェニレンホスホナイト等の亜 リン酸のトリエステル、又はエステル部をアルキル基、 フェニル基、アルキルアリール基等で置換したジエステ ル、モノエステルがあげられる。これらは単独で使用し ても又は二種以上併用してもよい。かかる燐系熱安定剤 の配合量は、芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部 20 に対して0.0005~0.1重量部、より好ましくは 0.001~0.05重量部である。

【0070】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組成 物には、酸化防止の目的で通常知られた酸化防止剤を配 合することもできる。かかる酸化防止剤としては、例え ばペンタエリスリトールテトラキス(3-メルカプトプ ロピオネート)、ペンタエリスリトールテトラキス(3) ーラウリルチオプロピオネート)、グリセロールー3ー ステアリルチオプロピオネート、トリエチレングリコー ルービス[3-(3-tert-ブチル-5-メチルー 4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、1,6-30 ヘキサンジオールービス[3-(3,5-ジーtert ーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネー ト]、ペンタエリスリトールーテトラキス[3-(3, 5-ジーtert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート〕、オクタデシルー3ー(3,5ージー tertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオ ネート、1,3,5ートリメチルー2,4,6ートリス (3,5-ジーtert-ブチル-4-ヒドロキシベン ジル) ベンゼン、N, N-ヘキサメチレンビス(3,5 ージーtertーブチルー4ーヒドロキシーヒドロシン ナマイド)、3,5-ジーtert-ブチルー4-ヒド ロキシーベンジルホスホネートージエチルエステル、ト リス(3,5-ジーtert-ブチルー4-ヒドロキシ ベンジル) イソシアヌレート、4,4'ービフェニレン ジホスホスフィン酸テトラキス(2,4-ジーtert ーブチルフェニル)、3,9ービス{1,1ージメチル $-2-[\beta-(3-tert-)]$ -5-メチルフェニル)プロピオニルオキシ]エチル} -2, 4, 8, 10 - 7 - 50 ンデカン等が挙げられる。これら酸化防止剤の配合量

2.0

は、芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して 0.0001~0.05重量部が好ましい。

【0071】本発明で好ましく使用される紫外線吸収剤 は、具体的に、ベンゾフェノン系では、2,4-ジヒド ロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシ ベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-オクトキシベン ゾフェノン、2-ヒドロキシー4-ベンジロキシベンゾ フェノン、2-ヒドロキシー4-メトキシー5-スルホ キシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシー 5-スルホキシトリハイドライドレイトベンゾフェノ ン、2,2'ージヒドロキシー4ーメトキシベンゾフェ ノン、2,2',4,4'-テトラヒドロキシベンゾフ ェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキ シベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4' ージメトキシー5ーソジウムスルホキシベンゾフェノ ン、ビス(5-ベンゾイル-4-ヒドロキシ-2-メト キシフェニル)メタン、2-ヒドロキシ-4-n-ドデ シルオキシベンソフェノン、2-ヒドロキシ-4-メト キシー2'-カルボキシベンゾフェノン等があげられ、 ベンゾトリアゾール系では、2-(2-ヒドロキシー5 ーメチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒ ドロキシー5-tert-オクチルフェニル) ベンゾト リアゾール、2-(2-ヒドロキシ-3,5-ジクミル フェニル)フェニルベンゾトリアゾール、2-(2-ヒ ドロキシー3-tert-ブチル-5-メチルフェニ ル) -5-クロロベンゾトリアゾール、2,2'ーメチ レンビス[4-(1,1,3,3-テトラメチルブチ ν) -6-(2N-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール]、2-(2-t)にはキシー3,5ージーtertーブチルフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(2 ーヒドロキシー3,5ージーtertーブチルフェニ ル) -5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2-ヒド ロキシー3, 5ージーtertーアミルフェニル) ベン ゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシー5-tert ーオクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシー5ーtertーブチルフェニル) ベンゾト リアゾール、2-(2-ヒドロキシ-4-オクトキシフ ェニル) ベンゾトリアゾール、2,2 - メチレンビス (4-クミル-6-ベンゾトリアゾールフェニル)、 2, 2 ¹-p-フェニレンビス(1, 3-ベンゾオキサ 4,5,6-テトラヒドロフタルイミドメチル)-5-メチルフェニル]ベンゾトリアゾールがあげられ、これ らを単独あるいは2種以上の混合物で用いることが出来 る。好ましくは、2-(2-ヒドロキシ-5-tert ーオクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシー3,5-ジクミルフェニル)フェニルベン ゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-3-tert ーブチルー5ーメチルフェニル)-5-クロロベンゾト

リアゾール、2, 2'ーメチレンビス[4-(1, 1,

3,3ーテトラメチルブチル)-6-(2N-ベンゾト リアゾール-2-イル)フェノール]である。

【0072】本発明で好ましく使用する離型剤は、その90%重量以上が一価アルコールと一価脂肪酸のエステルおよび/または多価アルコールと脂肪酸のフルエステルからなる離型剤である。

【0073】本発明で配合される離型剤の中に遊離の脂肪酸や遊離のアルコール、あるいは、多価アルコールの部分エステルが存在すると本発明の目的を達成することができない場合がある。

【0074】本発明で好ましく使用する離型剤であると ころの一価または多価アルコールの高級脂肪酸フルエス テルは、炭素原子数1~20の一価または多価アルコー ルと炭素原子数5~30の飽和脂肪酸とのフルエステル であることが好ましい。かかる一価または多価アルコー ルと飽和脂肪酸とのフルエステルとしては、ステアリル ステアレート、パルミチルパルミテート、ブチルステア レート、メチルラウレート、イソプロピルパルミテー ト、2-エチルヘキシルステアレート、ステアリン酸モ ノグリセリド、ステアリン酸トリグリセリド、ソルビタ ンジステアレート、ペンタエリスリトールテトラステア レート、ペンタエリスリトールテトラペラルゴネート、 プロピレングリコールジステアレート等が挙げられ、単 独あるいは二種以上の混合物で用いることができる。な かでも、ステアリン酸モノグリセリド、ステアリン酸ト リグリセリド、ステアリルステアレート、ペンタエリス リトールテトラステアレートが好ましく用いられる。

【0075】本発明で好ましく用いるブルーイング剤の配合量は、樹脂組成物全体の0.05~10ppmであり、好ましくは、0.1~3ppmである。配合量が多すぎるとシート製品等の成形品の青みが強くなって視感透明度が低下し、少なすぎると黄色味を低減し自然な透明感を付与するというブルーイング剤の効果が発現しない場合がある。

【0076】具体的なブルーイング剤としては、例えば 一般名Solvent Violet13 [CA. No (カラーインデックスNo)60725;商標名 バイ エル社製「マクロレックスバイオレットB」、三菱化学 (株) 製「ダイアレジンブルーG」、住友化学工業 (株) 製「スミプラストバイオレットB」]、一般名S olvent Violet31 [CA. No6821 O; 商標名 三菱化学(株) 製「ダイアレジンバイオレ ットD」 、一般名Solvent Violet33 [CA. No60725; 商標名 三菱化学(株) 製 「ダイアレジンブルーJ」]、一般名Solvent Blue94 [CA. No61500; 商標名三菱化学 (株)製「ダイアレジンブルーN」]、一般名Solv ent Violet36[CA. No68210;商 標名 バイエル社製「マクロレックスバイオレット3 50 R」]、一般名Solvent Blue 97 [商標名

バイエル社製「マクロレックスブルーRR」] および 一般名Solvent Blue45[CA. No61 110;商標名 サンド社製「テトラゾールブルーRL S」〕、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社のマクロ レックスバイオレットやトリアゾールブルーRLS等が あげられ、特に、マクロレックスバイオレットやトリア ゾールブルーRLSが好ましい。

21

【0077】本発明で好ましく使用する光拡散剤は、一 般にプラスチックの光拡散板に使用されている無機微粒 リカアルミナ系粘土鉱物(含水珪酸アルミニウム類)、 タルクに代表されるシリカマグネシウム系粘土鉱物(含 水珪酸マグネシウム類)、硫酸バリウム、珪酸カルシウ ム、シリカアルミナ、炭酸カルシウム、酸化チタン、酸 化珪素等が挙げられる。また、有機微粒子としては架橋 構造を有する架橋ポリアクリレート、架橋ポリスチレン 等が挙げられる。特に炭酸カルシウム、硫酸バリウム、 架橋ポリアクリレート及び架橋ポリスチレンが芳香族ポ リカーボネート樹脂への分散性が優れ好ましいものであ る。使用量は芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部 20 に対し0.01~30重量部の範囲で、好ましくは0. 1~5重量部の範囲ある。

【0078】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂の分 子量は、粘度平均分子量(M)で10,000~50. 000であり、10,000~45,000が好まし く、12,000~30,000がより好ましい。かか る粘度平均分子量を有する芳香族ポリカーボネート樹脂 は、押し出し加工時の良好な流動性を保ちながら、同時 に、得られた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関し* *ても一定の機械的強度を有するので好ましい。また、光 ディスク用途では、10,000~20,000がさら に好ましく、12,000~17,000が最も好まし

【0079】本発明でいう粘度平均分子量は、塩化メチ レン100m1に芳香族ポリカーボネート樹脂0.7g を20℃で溶解した溶液を用いて測定された比粘度(ヵ sp)から求める。

【0080】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂にリ 子や有機微粒子でよく、例えばカオリンに代表されるシ 10 ン系安定剤や添加剤を配合するには、任意の方法が採用 される。例えば溶融重合終了後ポリカーボネート樹脂を 溶融状態に保ったままリン系安定剤や添加剤を添加する 方法やタンブラー、V型ブレンダー、スーパーミキサ ー、ナウターミキサー、バンバリーミキサー、混練ロー ル、押出機等で混合する方法が適宜用いられる。こうし て得られる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物は、その まま又は溶融押出機で一旦ペレット状にしてから用いる ことができる。

[0081]

【実施例】以下に実施例をあげて本発明を更に説明す る。なお、実施例中の部は重量部であり、評価は下記の 方法によった。

【0082】(1)相対蛍光強度

下記条件により測定した芳香族ポリカーボネート樹脂の 465 nm (励起波長320 nm) における蛍光強度を 基準物質の蛍光強度を測定し、その比(相対蛍光強度= 芳香族ポリカーボネート樹脂の蛍光強度/基準物質の蛍 光強度)を計算した。

測定条件 装置

日立F4500 ランプ Xe, 150W

スリット巾 Ex/Em各2.5mm

ホトマル 400W

サンプル(濃度) 1 m g 芳香族ポリカーボネート樹脂/5 m l

※した。

塩化メチレン

比較基準物質: サルチル酸フェニル1. 0×10^{-3} mg/m 1 塩化メチレン

【0083】(2)粘度平均分子量

オストワルド粘度計を用いて芳香族ポリカーボネート樹 脂0.7gを塩化メチレン100m1に溶解した溶液の 比粘度 η S P を 2 0 ℃で測定し、下記式より粘度平均分子 40 量Mを算出した。

 $\eta_{SP}/c = [\eta] + 0.45 \times [\eta]^2 c (但し[\eta])$ は極限粘度)

 $[\eta] = 1.23 \times 10^{-4} M^{0.83}$ c = 0.7

【0084】(3)末端水酸基濃度

芳香族ポリカーボネート樹脂 0.02gを0.4m1の クロロホルムに溶解し、20℃で1H-NMR(日本電 子社製EX-270)を用いて末端水酸基および末端フ ェニル基を測定し、下記式により末端水酸基濃度を測定※50

末端水酸基濃度(モル%)=(末端水酸基数/全末端 数)×100

【0085】(4)接着性(接着強度)

押出成形機を用いて厚さ2mmの芳香族ポリカーボネー ト樹脂組成物シートを得た。このシートの片面に可視光 硬化型接着剤「(株)アーデル BENEFIX P C]を塗布し、同じシートを気泡が入らないように一方 に押し出すようにしながら積層後、可視光線専用メタル ハライドタイプを備えた光硬化装置により5、000m J/cm²の光を照射して得られた積層板の接着強度を JIS K-6852 (接着剤の圧縮せん断接着強さ試 験方法)に準拠して測定した。

(5)成形耐熱性

23 射出成形機を用いて芳香族ポリカーボネート樹脂組成物

ペレットを成形温度350℃、1分サイクルで「滞留前

の色相測定用平板」(70mm×50mm×2mm)に

成形した。さらに、シリンダー中に樹脂を10分間滞留

させた後、「滞留後の色相測定用平板」を得た。滞留前*

*後の平板の色相を色差計により測定し、次式により色差 △Eを求めた。表に示した値(△E)が小さいほど成形 耐熱性が優れることを示す。

24

[0086]

【数1】

 $\triangle E = \sqrt{(L - L')^2 + (a - a')^2 + (b - b')^2}$

滞留前の色相:L、a、b

滞留後の色相: L'、 a'、 b'

【0087】(6)耐湿熱疲労性

図1に示したいわゆるC型の測定用サンプル(芳香族ポ リカーボネート樹脂組成物)を用いて、80℃、90% RHの雰囲気で、正弦波で振動数1Hz、最大荷重2k gの条件で、以下の疲労試験機[(株)島津製作所製 島津サーボパルサー EHF-EC5型]を用いて、測 定用サンプルが破断するまでの回数を測定した。表に示 した値(破断するまでの回数)が大きいほど、耐湿熱疲 労性に優れることを示す。

(7)高温高湿処理後の白色欠点

芳香族ポリカーボネート樹脂組成物ペレットを用いてデ ィスク成形機 [住友重機(株)製DISK3 MIII] により光ディスク用基板(直径120mm、厚さ1.2 mm)を成形した。過酷な雰囲気下に長時間放置した時 の白点の増加を再現する為に、ディスクを温度80℃、 相対湿度85%に制御した恒温恒湿槽に1000時間保 持し、その後偏光顕微鏡を用いて20μm以上の白色欠 点の数を数えた。これを25枚の光学用ディスク基板 (直径120mm)について行い、その平均値を求め、 これを白色欠点個数とした。

【0088】[参照例1] ビスフェノールA、228重 量部、ジフェニルカーボネート218重量部及びエステ ル交換触媒; ビスフェノールAのNa2塩(1.36× 10⁻⁵重量部; NaとしてO. 1μmol/1molビ スフェノールA)及びテトラメチルアンモニウムヒドロ キシド(9.1×10⁻³重量部;100μmo1/1m ○ 1 ビスフェノールA)を撹拌装置、蒸留塔及び減圧装 置を備えた重合槽に仕込み窒素置換した後、140℃で 溶解した。30分間撹拌後、内温を180℃に昇温し、 内圧100mmHg30分間反応させ、生成するフェノ ールを溜去した。ついで内温を200℃に昇温しつつ徐 々に減圧し50mmHgで30分間フェノールを溜去し つつ反応させた。更に220℃、30mmHgまで徐々 に昇温、減圧し、同温度、同圧下で30分間、更に、2 40℃、10mmHg、250℃、1mmHgまで上記 と同じ手順で昇温、減圧を繰り返し反応を続行した。 【0089】最終的に250~255℃で(常に255

℃以下に保つよう留意した)、また重合槽撹拌翼の撹拌 剪断速度(単位:1/sec)を撹拌翼半径(単位:c※50 6×10‐3 重量部;Naとして10μmol/1mol

※m)の2乗で割った数値を0.001(1/sec×c m²) に保ちつつポリカーボネートの重縮合を継続し た。

【0090】重縮合終了後末端停止剤として2-メトキ シカルボニルフェニルフェニルカーボネート1.8部を 添加した。その後255℃、1 Torr以下で10分間 末端封鎖反応を行った。次に溶融状態のままで、触媒失 活剤としてドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルホ 20 スホニウム塩を0.00029部(5×10⁻⁷モル/ビ スフェノール1モル)添加して255℃、10Torr 以下で反応を継続し、粘度平均分子量24,300、末 端水酸基濃度14モル%、相対蛍光強度1×10-3の芳 香族ポリカーボネート樹脂を得た。以下、この芳香族ポ リカーボネート樹脂をPC-1と略称する。

【0091】 [参照例2] PC-1においてエステル化 触媒をNaOH0. 00004部(1μmo1/1mo 1ビスフェノールA)に変えた以外は実施例1と同様な 操作を行い、粘度平均分子量24,300、末端水酸基 30 濃度16モル%、相対蛍光強度2×10-3の芳香族ポリ カーボネート樹脂を得た。以下、この芳香族ポリカーボ ネート樹脂をPC-2と略称する。

【0092】[参照例3]末端停止剤として2-メトキ シカルボニルフェニルフェニルカーボネートを用いない 以外はPC-1と同様な操作を行い、粘度平均分子量2 4,300、末端水酸基濃度52モル%、相対蛍光強度 1×10⁻³の芳香族ポリカーボネート樹脂を得た。以 下、この芳香族ポリカーボネート樹脂をPC-3と略称 する。

【0093】[参照例4]末端停止剤として2-メトキ シカルボニルフェニルフェニルカーボネートを用いない 以外はPC-1と同様な操作を行い、粘度平均分子量1 4,600、末端水酸基濃度54モル%、相対蛍光強度 1×10⁻³の芳香族ポリカーボネート樹脂を得た。以 下、この芳香族ポリカーボネート樹脂をPC-4と略称

【0094】「比較参照例1] ビスフェノールA、22 8重量部、ジフェニルカーボネート220重量部及びエ ステル交換触媒;ビスフェノールAのNa2塩(1.3 25 ビスフェノールA)及びテトラメチルアンモニウムヒド

ロキシド(9.1×10⁻³重量部;100 μ mo1/1

molビスフェノールA)を撹拌装置、蒸留塔及び減圧

装置を備えた重合槽に仕込み窒素置換した後、140℃ で溶解した、30分間撹拌後、内温を180℃に昇温

し、内圧100mmHg30分間反応させ、生成するフ

ェノールを溜去した。ついで内温を200℃に昇温しつ

つ徐々に減圧し50mmHgで30分間フェノールを溜

去しつつ反応させた。更に220℃、30mmHgまで

徐々に昇温、減圧し、同温度、同圧下で30分間、更

26
*【0098】尚、表1、2記載のリン系安定剤等は以下
の通りである。

●B-1安定剤

テトラキス (2, 4-ジ-t-ブチルフェニル)-4, 4'-ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス <math>(2, 4-ジ-t-ブチルフェニル)-4, 3'-ビフェニレンジホスホナイトおよび、テトラキス <math>(2, 4-ジ-t-ブチルフェニル)-3, 3'-ビフェニレンジホスホナイトの100:50:10 (重量比) 混合物

10 **②**B-2安定剤

ビス(2,4-ジーtert-ブチルフェニル)-4-フェニルーフェニルホスホナイトおよびビス(2,4-ジーtert-ブチルフェニル)-3-フェニルーフェニルホスホナイトの5:3(重量比)混合物

③B−3安定剤

トリス(2, 4- i)ーtert-ブチルフェニル)ホスファイト(安定剤中のC1含有量20ppmおよび52ppm)

♠B-4安定剤

0 トリメチルホスフェート (安定剤中のC 1 含有量 6 4 0 0 p p m)

⑤B-5安定剤

ジオクタデシルペンタエリスリトールジホスファイト (安定剤中のC1含有量5000ppm)

⑥B-6安定剤

ジメチルフェニルホスホネート (安定剤中のC 1 含有量 4600 p p m)

⑦亜リン酸

[0099]

【表1】

に、240 $^{\circ}$ 、10 mmHg、250 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 1 mmHgまで上記と同じ手順で昇温、減圧を繰り返し反応を続行した。

【0095】最終的に280 $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0096】[比較参照例2]芳香族ポリカーボネート 樹脂の粘度平均分子量を変更した以外は、CEX-1と 同様な操作を行い、粘度平均分子量14,600、末端 水酸基濃度52モル%、相対蛍光強度6×10⁻³であっ た。以下、この芳香族ポリカーボネート樹脂をCEX-2と略称する。

【0097】[実施例1~10、比較例1~2]表1、2記載の芳香族ポリカーボネート樹脂ペレットとリン系安定剤またはその組成物を表1、2記載の重量基準でブレンドし、押出機を用いてペレット化した。このペレットを用いて各種の評価を行い、その結果を表1、2に示30した。

		D-16-751-4	cht Maria	ED 167 (2) (2)	CD-MC/DLA	cht-cole	中块加点	実施例7	比較例1
		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6		
芳香族ポリ カーボネート樹脂	種類	PC - 1	PC-1	PC-1	PC-1	PC-1	PC-2	PC-3	CEX-1
	蛍光 強度	1 × 10 ⁻³	1×10^{-3}	1×10^{-8}	1×10^{-3}	1×10 ⁻⁸	2 × 10 ⁻³	1×10 ⁻³	6×10^{-3}
	末端水酸基濃度(モル%)	14	14	14	14	14	16	54	51
	粘度平均分子量	24300	24300	24300	24300	24300	24300	24300	24200
リン系安定剤組成物中のCI含有量(ppm)		1100	20	6400	5000	4600	1100	1100	52
	①8-1安定剤	71					71	71	
	②B-2安定剤	15					15	15	
┃ リン系安定剤組成	③B-3安定剂	14	100				14	14	100
(重量%)	④B-4安定剤			100					
	⑤B-5安定剤				100				
	⑥B-6安定剂					100			
PC100重量部に対する		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
リン系安定剤組成物の添加量(重量部)									
	接着強度(Kgf/cm²)	127	122	121	120	119	127	1 15	99
評価結果	成形耐熱性 Δ E(340°C)	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11	0.07	0.09	0.32
	耐湿熱疲労性	6.8×10^{3}	6.6×10^3	5.5×10^3	5.6 × 10 ³	52×10 ³	6.6×10 ³	5.9×10^3	3.2×10^{3}

[0100]

※ ※【表2】

		実施例8	実施例9	実施例10	比較例2
	種類	PC-4	PC-4	PC-4	CEX-2
芳香族ポリ	蛍光強度	1×10 ⁻⁸	1×10 ⁻³	1×10^{-3}	6×10 ⁻³
カーボネート樹脂	末端水酸基濃度(モル%)	54	54	54	51
	粘度平均分子量	14600	14600	14600	14600
リン系安定剤組成物・	中のCI含有量(ppm)	1100	20	12	52
	①B-1安定剤	71			
(重量%)	②B-2安定剤	15			
	③B-3安定剤	14	100	60	100
Ø	重燐酸			40	
PC100重量部に対す	ర్	0.03	0.03	0.0025	0.03
リン系安定剤組成物の添加量(重量部)					
	成形耐熱性∆E(340°C)	0.07	0.08	0.12	0.3
評価結果	耐湿熱疲労性	6.2×10^{3}	6.1×10^{3}	5.2×10^{3}	2.9×10^{3}
	白色欠点	0.2	0.3	0.1	5.4

[0101]

【発明の効果】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組 成物は、ポリカーボネート樹脂本来の透明性を保ちつ つ、成形耐熱性、耐湿熱疲労性、接着性に優れ、また高 温高湿下で長時間放置した際、光ディスク基板内に10 ~100 μ程度の球状の白色欠点が発生し難い芳香族ポ リカーボネート樹脂組成物である。それ故、光ディス ク、眼鏡レンズ、フレンネルレンズ、人工腎臓、ボト ル、自動車、新幹線等の車両や住宅の窓ガラス用シー ト、アーケード、防風・防音・防雪用の道路壁、位相差 フィルム等の各種工業用途に用いられ、特に光ディス ク、シート用途に有用であり、その工業的価値が高い。 【図面の簡単な説明】

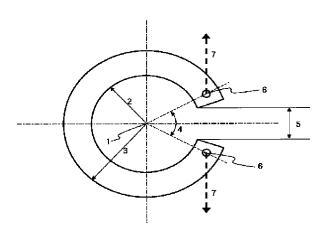
【図1】耐湿熱疲労性を評価するために使用した、いわ*

*ゆるC型サンプルの正面図である。なおサンプルの厚み は3mmである。符号6で示される孔の部分に試験機の 治具を通し、符号7で示される垂直方向に所定の荷重を かけて試験を行う。

【符号の説明】

- C型形状の二重円の中心
- 2 二重円の内側円の半径(20mm)
- 二重円の外側円の半径(30mm) 3
- 治具装着用孔の位置を示す中心角(60°) 20 4
 - 5 サンプル端面の間隙(13mm)
 - 治具装着用孔(直径4mmの円であり、サンプル 幅の中央に位置する)
 - 疲労試験時におけるサンプルに課される荷重の方

【図1】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4J002 CG001 CG011 CG021 CG031 EW046 EW066 EW086 EW106 EW126 FD036 GB01 GG01 GL00 GM00 GN00 GP00 GP01 4J029 AA09 AB01 AD01 AD10 AE05 BB04A BB05A BB10A BB12A

9 AAO9 ABO1 ADO1 AD10 AEO5 BBO4A BBO5A BB10A BB12A BB12B BB12C BB13A BB13B BB16C BC05A BC06A BD09A BD09B BD09C BE05A BE07 BF03 BF14A BF26 BG03 BG08X BG08Y BH02 DB07 DB11 DB13 HC03 HC04A HC05A HC05B JA091 JA121 JA161 JA201 JB183 JC091 JC093 JC472 JC482 JC582

JC633 JF021 JF031 JF041

PAT-NO: JP02001031752A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001031752 A

TITLE: AROMATIC POLYCARBONATE RESIN

COMPOSITION

PUBN-DATE: February 6, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OHIRA, YOJI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TEIJIN CHEM LTD N/A

APPL-NO: JP11207247

APPL-DATE: July 22, 1999

INT-CL (IPC): C08G064/04 , C08G064/30 ,

C08K005/49 , C08L069/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polycarbonate resin composition having excellent molding— heat resistance, resistance to wet—heat fatigue, and adhesiveness as well as its inherent transparency and giving an optical disc scarcely forming spherical white defects even when left for a long time by compounding an aromatic polycarbonate resin having a specified relative fluorescent

intensity and a specified viscosity-average molecular weight with a phosphorus stabilizer having a specified concentration of phosphorous acid, chlorine atoms, and chloride ions in a specified ratio.

SOLUTION: This composition is prepared by compounding 100 pts.wt. aromatic polycarbonate resin having a relative fluorescent intensity of at most 4×10-3 and a viscosity-average molecular weight of 10,000-50,000 and obtained by the melt polymerization of a dihydrie phenol and a carbonic ester with 0.0001-0. 15 pt.wt. mixture comprising phosphorus stabilizers represented by the formula (wherein Ar1 is an aromatic group optionally having alkyl substituents) and a like formula and having a total concentration of phosphorous acid, chlorine atoms, and chlorine ions of 1-11,000 ppm. The dihydric phenol is desirably a homopolymer of bisphenol A, and the carbonic ester is desirably diphenyl carbonate.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO